DAEHAN HWAHAK HWOEJEE (Journal of the Korean Chemical Society) Vol. 29, No. 2, 1985 Printed in the Republic of Korea

## 산화주석 얇은 막 전극에서의 이산화황 산화반응

洪鍾仁<sup>1</sup>、白雲基·金夏庚\* 서강대학교 이공대학 화학과 \*서울대학교 자연과학대학 화학과 (1984. 10. 11 접수)

# Electrochemical Oxidation of Sulfur Dioxide on Tin Oxide Thin Film Electrode

Jong In Hong<sup>†</sup>, Woon-kie Paik and Hasuck Kim\*

Department of Chemistry, Sogang University, Seoul 121, Korea \*Department of Chemistry, Seoul National University, Seoul 151, Korea (Received October 11, 1984)

요 약. 안티몬이 첨가된 산화주석 얇은막 전극의 반도체적 성질을 조사하고 이산화황의 산화반응에 대한 이 전극의 전기화학적 촉매작용을 여러가지 조건하에서 조사하였다. SO<sub>2</sub>(또는 아황산염)를 포함하는 전해질 용액의 pH가 증가함에 따라 점차로 낮은 전위에서 산화가 일어났으며 이 전극은 염기성 용액에서 SO<sup>3</sup>3의 산화에 대하여 뚜렷한 전기촉매 작용을 나타내었으며 이 전기촉매 작용은 백금이나 팔라듐 전극의 촉매작용과는 다른 특성을 보여주었다. 백급이나 팔라듐이 이 전극에 참가된 경우에는 이들 금속이 전극표면에 노출된 양에 비례하는 효과만이 나타났다.

ABSTRACT. The semiconducting property of Sb-doped tin oxide thin film electrode was investigated and the electrocatalytic effect of this electrode for SO<sub>2</sub> (or sulfite, bisulfite ions) oxidation reaction was studied under various conditions. The anodic oxidation of SO<sub>2</sub> at tin oxide thin film electrode commenced at lower potential with increasing pH, and good electrocatalytic effect was shown of SO<sub>3</sub>= oxidation in basic solution. In the acidie solutions the electrocatalytic effect of platinum- or palladium-incorporated tin oxide electrode was found to be due to the sites of Pt or Pd exposed on the electrode surface. The electrocatalytic effect of tin oxide electrode was distinctive from that of Pt- or Pd- containing electrodes.

#### 서 쿈

산화주석은 상당히 큰 band gap (3.7eV)을 가진 n-형 반도체 물질이며 투명한 기질에 고착 된 산화주석 얇은 막은 광학적 투명성, 부식에 대한 큰 저항성과 수소와 산소에 대한 비교적

†Present adress: Research and Q.C. Division, HAN-IL Pharmaceutical Ind. Co., LTD. Seoul, Korea. 큰 과전압 동의 독특한 성질 때문에 전기화학적, 광전기화학적인 연구에서 전국으로 많이 이용되고 있으며 이의 전기화학적 축매작용은 연구의 대상이 되어 오고 있다<sup>1~5</sup>.

산화주석 얇은 막은 다결정성이고 그의 전기전 도도는 SnCl<sub>4</sub>의 불완전 분해로 남은 염소 이온 과 불완전 산화로 인한 산소의 화학양론적 결 핍 때문으로 알려지고 있다<sup>6</sup>. 또 이들의 전기 전 도도는 전극을 만드는 방법, 열처리 조건, 그리고 참가되는 불순물들에 따라 달라짐이 Marton<sup>7</sup> 등에 의해 보고되었고 Carrol<sup>8</sup> 등은 3 쪽원소를 불순물로 참가했을때 막의 비저항이 증가되고 5 쪽 원소를 참가할 경우 비저항이 감소되지만 과량을 참가하면 오히려 비저항이 증가됨을 보고하였다.

n-형 반도체인 SnO<sub>2</sub> 막을 만들때 SnCl<sub>4</sub> 용액에 소량의 SbCl<sub>3</sub>를 참가하여 가열 산화하면 Sb는 산화주석 격자속에서 Sn(IV)과 교체되면서 전자주게 역할을 하여 Carrier 농도를  $10^{20}/\text{cm}^3$ 이상으로 증가시킬 수도 있다<sup>2</sup>.

본 연구는 산화주석 얇은막 전극의 전기화학 적 촉매효과를 알아보기 위한 시도로서 이산화 황의 전해산화반응을 여러가지 조건하에서 주로 순환전압-전류곡선 방법으로 조사하였고 또한 이 전극에 백금이나 팔라듐을 주입시켰을 경우 어떤 효과를 보이는지 조사하였다.

#### 실 헑

산성화된 SnCl₄ 산화주석 얇은 막 전극제조. 수용액을 가열된 유리판 위에 분무하여 열분해 산화시키는 방법을사용하였다^10. 분무용엑으 로는 2M HCl 용액에 SnCl₄·5H₂O 결정을 녹여 Sn 농도를 2mole/l로 만들었으며 첨가물로는 SbCl<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>·2H<sub>2</sub>O 또는 PdCl<sub>2</sub>를 사용하였다. 시약은 분석용 등급으로 특별한 정제과정을 거 차지 않고 그대로 사용했으며, 기질로는 소오다 유리인 현미경 받침유리를 썼고 분무개스는 정 제된 질소 개스를 사용하였다. 분무는 열판위 20cm 이상의 거리에서 했고 300°C에서 열분해 지켰으며 빛의 간섭에 의해 나타나는 붉은색이 세번째 나타날 때 가지 20~30회 이상을 분무하 였고 각 분무시간은 5초이내로 하였다. 본 실험 에서 사용된 모든 산화주석막 전국은 전기 전도 도를 증가시키기 위하여 안티모니를 혼입 (doping)한 것으로서 혼입의 방법으로 SnCl. 용액에 SbCl3를 Sb/Sn 물 비가 0.02이 되도록 섞은 것 을 분무하였다. 백금 혹은 팔라듐을 주입한 산 화주석 막 전극을 만들때도 역시 안티모니를 혼 입하였다. 제조된 전국의 표면을 0.05μ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 분말로 연마한후 재증류수로 충분하 씻고 이소 프로판을 속에서 약 10분간 끓여 기름때를 제거 한후 유기물을 제거하기 위하여 다시 재증류수 에서 끓인후 실온에서 건조시켰다.

Capacitance 즉정. 시료전극의 반도체적 특성을 조사하기 위해 전국-전해질 용액간의 시차 커패시턴스(differential capacitance)를 측정하였다. 5mV, 0.25~2kHz의 삼자파 전위를 시료전 국에 가해주면 전극과 용액간에 형성되는 이중층의 커패시턴스에 의하여 사자파의 전류 응답을 얻게되는데 이 사자파의 높이가 커패시턴스에 직접 비례하게 된다. 그러나, 실제로는 전해질 용액이 갖는 저항 성분들 때문에 정확한 사자파를 얻기가 힘들고 약간의 삼자파 성분이 섞여 있는 사자파를 얻게 되므로 위상차건출을 이용하는 Lock-in amplifier를 사용하여 측정 신호를 dc로 변환시켜 측정하였다.

커패시턴스를 측정하기 위한 Cell은 세개의 전 국, 즉 작업전국, 기준전국 및 대전국을 갖추었고 대전국으로는 백금 망을 사용하여 표면적을 크게하였으며, 기준전국으로는 포화 칼로멜 전국 을 사용하였는데 염소 이온의 유출과 용액의 저 항성분 때문에 생기는 IR 전위차는 Luggin 모세 관으로 최소화 하였다.

이산화황의 전해산화반응 측정. 측정에 사용된 cell은 capacitance 측정때와 동일하며 이산화황은 Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 염을 용액에 넣어서 생기도록하였는데 공기 접촉에 의한 산화를 막기 위해지지전해질 용액을 먼저 준비하여 고순도의 질소 개스를 통과시켜 산소를 완전히 제거한후 Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 염을 첨가시켰다. 용액속에서 SO<sub>2</sub>와 그가수분해 반응의 평형으로 존재하는 HSO<sub>3</sub><sup>-</sup>, SO<sub>3</sub><sup>=</sup>이온들은 용액의 pH에 따라서 결정되는 농도 비로 존재할 것이다.

시약 및 기구, 시약은 모두 분석용 등급을 그대로 사용하였으며 실험에 사용된 물은 1차 중류물을 약 염기성 용액으로 만들고 KMnO4를 소량 참가하여 중류한 비전도도가 10<sup>-7</sup>ohm<sup>-1</sup>cm<sup>-1</sup>인 중류수이다. 순환전압-전류곡선을 얻기 위하여 PAR Model 173 Potentiostat 과 PAR Model 175 Universal Programmer 를 사용하였다.

Lock-in amplifier는 본 실험실에서 제작한 것 올 사용하였다.

#### 결과 및 논의

**Capacitance 측정.** 안티몬이 첩가된 산화주석 막 전국과 용액간에서 얻어진 시차 커패시턴스로 부터 얻어진 Mott-Schottky 그림은 *Fig.*1과 같고 250Hz와 500Hz의 두 주파수에서만 일치하는 직선을 얻었는데 이 주파수를 기준하여 Mott-Schottky 관계식으로부터<sup>11</sup> 산화주석의 유전상수 값 €률 12.7로² 하였을 때 얻어진 시료 전국의 Carrier 농도는 대략 1.0×10²²/cm³으로 나타났다. 이값은 Laitinen²과 Kuwana¹²등이 사용한 산화주석 막 전국의 Carrier 농도인 10²¹/cm³보다 더 큰 값이다.

이산화황의 산화반응. 산화주석막 전국에서의 이산화황 산화반응을 여러가지 pH의 완충 용액 을 지지 전해질로 사용하여 순환전압-전류곡선 을 얻는 결과는 Fig. 2와 같다.

그림에서 알수 있듯이 pH가 증가함에 따라 점차 낮은 전위에서 산화가 일어났으며, 높은 pH 용액에서의 산화전류 밀도는 백금전국의 경우보 다도 낮은 전위에서 상승하였다. 이것으로 산화 주석막 전국이 염기성 용액에서 SO3\*의 산화에 대해 좋은 전기화학적 촉매효과를 보여 줌을 알 수 있다. 전국 산화전류의 Tafel 그림을 정상상 대 정전위 방법에 의해 구한 결과 두개의 서로 다른 기울기 값을 보여주었다(Fig.3). 그림에서 보듯이 0.5V에서 0.75V 까지의 산화반응은 232 mV (/decade)의 기울기 값을 가지며 0.8V 이상 의 전위에서는 83mV의 값을 보여준다. 급속전 극에서 이동 계수가 0.5일때 단일전자 이동에 대 한 Tafel 기울기 값은 120mV이며 2전자 혹은 3전자 이동반응의 경우는 더 작은 값을 나타내 므로 232mV의 기울기 값은 단일전자 반응에 해 당하나 이 전국이 반도체 성질을 가지는 때문에 큰 값으로 나타나는 것으로 생각된다. 즉 전하 분포층(space charge layer)13 때문에 전하이동 속도가 전극전위에 의존하는 민감도가 작아져서 이동 계수 α값은 0.5보다 훨씬 작을 것이란 점 을 감안할때 232mV의 기울기 값을 단일전자 이

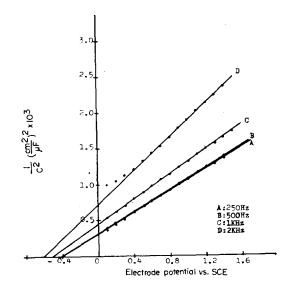


Fig. 1. 1/C<sup>2</sup> vs. potential. Sb-doped tin oxide electrode in 0.5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution.

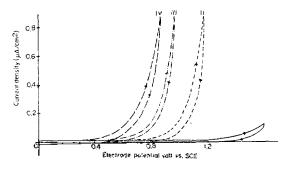
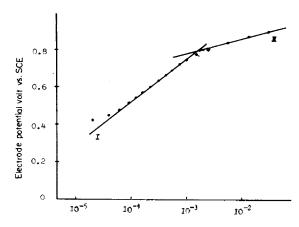


Fig. 2. Cyclic voltammogram with tin oxide electrode in 10 mM Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> solutions of various pH. I: pH 0.4, II: pH 4.6, III: pH 6.9, IV: pH 9.9, Scan rate: 100mV/sec.

동에 의한 값으로 생각할 수 있다. 따라서, 흡 착된 SO<sub>3</sub>=이온으로 부터 한개의 전자가 이동하 는 속도결정 단계를 가진 반응경로를 아태와 같 이 가정하였다.

나타내며 이값 역시 금속과의 차이를 고려할때, 이 반응의 속도 결정단계는 2개의 전자이동에

Journal of the Korean Chemical Society



Current density (m.4./cm²)

Fig. 3. Tafel plot for SO<sub>3</sub><sup>m</sup> oxidation at tin oxide electrode in pH 11.0 buffer solution.

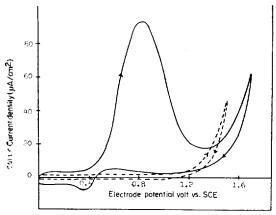


Fig. 4. Cyclic voltammogram with Pt-containing(—) and Pt-free(---) tin oxide electrodes in 0.5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +50 mM Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, Scan rate: 100mV/sec.

의한 다음과 같은 반응경로를 가정할 수 있다. SO<sub>3</sub>=(HSO<sub>3</sub>-) - (SO<sub>3</sub>=) ads (+H+) (SO<sub>3</sub>=) ads - (SO<sub>3</sub>) ads + 2e<sup>-</sup> (rate determining) (SO<sub>3</sub>) ads + 2OH<sup>-</sup> - SO<sub>4</sub>= + H<sub>2</sub>O

즉 산화주석 얇은막 전국에서의 SO3 이온의 산화반응은 위 두 가지 산화반응이 가능한데 0.5 'V에서는 단일전자 이동에 의한 반응이 우세하 게 일어나고 0.8V 이상에서는 주로 2개의 전자 이동에 의해 산화반응이 진행된다고 생각된다. 산화주석 막에 백급을 주입시켰을 때 이산화황 산화에 대하여 백급 주입이 없는 산화주석막 전 국에 비해 어떤 촉매효과를 보이는지를 순환전 압-전류곡선으로 알아보았다(Fig.4). 낮은 pH

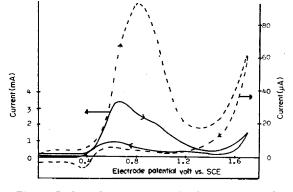


Fig. 5. Cyclic voltammogram with platinum electrode (---) and Pt-incorporated SnO<sub>2</sub> electrode (---) in 0.5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+50mM Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, Scan rate: 100mM/sec, Electrode surface area; Pt electrode: 0.17cm<sup>2</sup>, Pt-incorporated electrode: 0.98cm<sup>2</sup>.

용액에서의 전류-전압곡선은 Fig. 4와 같이 0.8 V 근처에서 뚜렷한 산화전류 봉우리를 나타내는 데 이 봉우리는 pH의 상승과 더불어 점점 작아 **저서 중성과 염기성 용액에서는 완전히 사라져** SnO2 전극과 같은 효과만을 보여주었다. 백금이 주입된 전극과 순수한 백급전극에서 얻어진 순 환전압-전류곡선은 Fig.5와 같다. 그림에서 알 수 있듯이 백금이 주입된 산화주석막 전극에서 일어나는 이산화황 산화반응은 순수한 백금전국 에서 일어나는 것과 같은 산화반응임을 알 수 있 다. 산화주석에 백금이 주입될 경우 전국표면에 노출되는 백금 site는 섬 형태의 독립된 grain으 로 존재한다고 보고되고 있는데 백급이 주입된 전극에서의 이산화황 산화반응은 전극표면에 노 출된 백금 site 에서 일어나는 것으로 생각된다. 양극 산화봉우리 전류가 주입된 백금량에 관계 되는 지를 조사하기 위해 2몰%의 백금이 주입 된 전극과 1 볼% percent 백금이 주입된 전국 에서 봉우리 전류밑도 값을 구한 결과 2몰% 백 금이 주입된 전국에서는 38.4μA/cm², 1몰% 백 금이 주입된 경우는 20.8μA/cm²로 주입된 양에 거의 비례하는 값을 나타내었다. P.W.T.Lu15 등은 진한 황산용액에서 이산화황의 양극산화에 대해 백금전국을 사용하여 Tafel 기울기를 구한 결과67mV의 기울기 값을 얻었다. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>염이 산성용액에 녹아있을 때 용액내에 존재할 화학

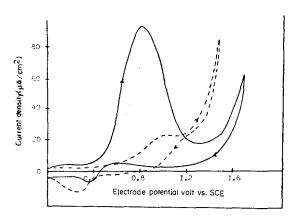


Fig. 6. Cyclic voltammogram with Sb-doped electrode containing Pt(-) and electrode containing Pd(...) in 0.5M H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>+50mM Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, Scan rate: 100mV/sec.

좋은 수화된 SO₂분자, HSO₃⁻, SO₃⁼이온 등이 있으나 전국 반응을 생각할때 용액내의 SO₂보다 HSO₃⁻의 반응성이 더 쿨 것으로 생각되며 2개의 전자이동이 속도 결정단계가 되는 가능한 반응경로를 다음과 같이 추정하였다.

 $HSO_3^- \Longrightarrow (HSO_3^-)_{ads}$  $(HSO_3^-)_{ads} \longrightarrow (SO_3)_{ads} + H^+ + 2e^-$ 

(rate determining)

## $(SO_3)_{ads} + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$

즉, HSO₃~이온이 먼저 전극표면에 흡착되어 전자를 2개 내어 주면서 (SO<sub>3</sub>)ada가 되며 이것 온 물과 반응하여 H₂SO₄가 되는 것으로 생각되 다. 팔라듐이 주입된 산화주석 얇은 막 전국의 순환전압-전류곡선은 백금이 주입된 경우와는 다 른 모양을 보여준다(Fig. 6). 이는 P. W. T. Lu<sup>15</sup> 등이 순수한 팔라듐 전극에서 얻은 순환전압-전 류곡선과 비슷한데 이들은 팔라듐에 흡착되는 산소를 가진 화학종이 1.0V 이상의 전위에서 산 화막을 형성하지만 이산화황의 전기화학적인 산 화반응을 방해하지 않는다고 보고하였다. 팔라 듐이 주입된 전극의 경우 백금이 주입된 전극에 비해 낮은 전위에서는 산화전류 값이 적으나 높 은 전위에서는 더 큰 산화 전류 값을 보여주고 있다. 이것은 전극표면에 노출된 팔라듐 site 에 서 형성되는 산화막이 백금 site 에서 와는 달라 이산화황의 산화를 방해하지 않기 때문으로 생 각된다.

백금을 주입한 경우나 팔라듐을 주입한 경우나 모두 그 전기촉매작용이 이들 주입금속과 산화주석사이의 상승적 작용이라고는 볼수 없으며 노출된 백금 또는 팔라듐표면에서 일어나는 반응들이 노출 면적에 비례하는 정도의 기여만을 나타내고 있다고 볼 수 있다. 한편, pH의 상승에 따라 감소하는 백금 또는 팔라듐의 전기촉매효과와는 반대로 이들 금속의 주입이 없는 산화주석막 전국에서는 pH상승에 따라 오히려 점점 낮은 전위에서 산화전류가 중가하는 것은 산화주석 전국의 독특한 전기촉매 작용이라고 볼수 있으며 염기성 용액에서 나타나는 이 산화주석의 전기촉매작용은 백금이나 팔라듐의 주입에 의하여 변화를 나타내지 않았다.

#### 감 사

이 연구는 1982년도 한국과학재단의 연구비 지 원으로 이루어 졌다. 이에 대하여 감사하는 바 이다.

### 인 용 문 원

- H. A. Laitinen, C. A. Vincent and T. M. Bednarski, J. Electrochem. Soc., 115, 1024(1968).
- D. Elliott, D. L. Zellmer, and H. A. Laitinen, ibid., 117, 1343(1970).
- C. Iwakura, M. Inai, T. Uemura and H. Tamura, Electrochim. Acta, 26, 579(1981).
- H. Kim and H.A. Laitinen, J. Electrochem. Soc., 122, 53(1975).
- M. S. Wrighton, D. L. Morse, A. B. Ellis,
   D. S. Ginely and H. B. Abrahamson, J. Amer.
   Chem. Soc., 98, 44(1976).
- C. A. Vincent, J. Electrochem. Soc., 119, 516 (1972).
- J. P. Marton and D.A. Lepic, *ibid.*, 123, 234 (1976).
- A. F. Garroll and L. H. Slock, *ibid.*, 123, 1889 (1976).
- H. Kim and H. A. Laitinen, J. Amer. Ceramic. Soc., 58, 23(1975).
- 10. 차형기, 서울대학교 대학원 석사학위 논문(1981).

- V. A. Myamlin and Yuv. Pleskov, "Electrochemistry of Semi-Conductors", (translated from Russian) Plenum Press, New York (1967).
- 12. N. R. Armstrong, A. W. C. Lin, M. Fujihira and T. Kuwana, *Anal. Chem.*, 48, 741(1976).
- 13. H. Gerischer, "Physical Chemistry, An Advanced Treatise", Vol. IXA, pp. 463~542, H. Egring,
- D. Henderson and W. Jost, ed., Academic Press, New York (1970).
- 14. H. Kim, Proc. '82 Summer Symposium, 과학기 술단체총연합회 pp. 155~167, KOFST(1982).
- P. W. T. Lu and R. L. Ammon, J. Electrochem. Soc., 127, 2610 (1980).